PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE

V. 23, No. 2 (2022) pp. 235-241

Section: Physics

DOI: 10.15330/pcss.23.2.235-241

Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

ФІЗИКА І ХІМІЯ ТВЕРДОГО ТІЛА Т. 23, № 2 (2022) С. 235-241

Фізико-математичні науки

УДК 537.311.322

ISSN 1729-4428

## В.А. Ромака<sup>1</sup>, Ю. Стадник<sup>2</sup>, Л. Ромака<sup>2</sup>, А. Горинь<sup>2</sup>, В. Пашкевич<sup>1</sup>, Г. Ничипорук<sup>2</sup>, П. Гаранюк<sup>1</sup>

# Дослідження термоелектричного матеріалу на основі твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb. I. Експериментальні результати

<sup>1</sup>Національний університет "Львівська політехніка", Львів, Україна, <u>volodymyr.romaka@gmail.com;</u> <sup>2</sup>Львівський національний університет ім. І.Франка, Львів, Україна, <u>lyubov.romaka@gmail.com</u>

Вивчено вплив легування фази пів-Гейслера *p*-LuNiSb (структурний тип MgAgAs) атомами Zr на структурні, кінетичні, енергетичні та магнітні характеристики напівпровідникового твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb у діапазонах: T = 80 - 400 K, x = 0 - 0,10. Експериментально встановлено, що при легуванні сполуки *p*-LuNiSb атомами Zr одночасно генеруються як структурні дефекти акцепторної природи, так і донорної, концентрація яких росте при збільшенні вмісту атомів Zr. Показано, що досліджений напівпровідниковий твердий розчин Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb є перспективним термоелектричним матеріалом. Ключові слова: напівпровідник, електропровідність, коефіцієнт термо-ерс, рівень Фермі.

Подано до редакції 14.09.2021; прийнято до друку 18.04.2022.

## Вступ

Мало дослідженим, однак перспективним класом напівпровідникових термоелектричних матеріалів з високою ефективністю перетворення теплової енергії в електричну, є тверді розчини на основі фаз пів-Гейслера RNiSb (R – рідкісноземельні метали підгрупи Ітрію) [1], які кристалізуються у структурному типі MgAgAs (пр. група F43m) [2]. У працях [3, 4] досліджено структурні, електрокінетичні та магнітні характеристики сполук RNiSb (R = Gd, Tb, Dy, Yb, Lu). Авторами встановлено, що кристалічна структура сполуки YbNi0.9Sb є дефектною, а самі сполуки є напівпровідниками діркового типу провідності. Дефектність кристалічної структури встановлено і для сполук пів-Гейслера ScNi<sub>0.87</sub>Sb і ScPd<sub>0.96</sub>Sb, які характеризуються наявністю вакансій в позиціях перехідного металу [5]. Отже, у кристалі існує механізм генерування структурних дефектів акцепторної природи. Однак автори не запропонували моделі структури та механізму генерування дефектів, би адекватно пояснювали результати які

експериментальних досліджень, зокрема, сполуки LuNiSb.

Дану проблему було розв'язано у роботах [6, 7]. Для встановлення моделі кристалічної та електронної структур сполуки LuNiSb використано метод ітераційного моделювання структурних, термодинамічних та кінетичних енергетичних, характеристик матеріалів з урахуванням результатів вимірювань температурних залежностей питомого електроопору  $\rho$ , коефіцієнта термо-ерс  $\alpha$  та магнітної сприйнятливості у [1]. Розрахунки розподілу густини електронних станів DOS проведені для різних варіантів розташування атомів у вузлах елементарної комірки і ступеню занятості позицій власними і/або чужими атомами. Шукали ступінь компенсації забезпечить експериментально *p*-LuNiSb, яка встановлене положення рівня Фермі є<sub>F</sub> відносно вершини валетної зони. Моделювання електронної структури *p*-LuNiSb показало, що лише при наявності вакансій (Va) (~ 6 %) у кристалографічній позиції 4c атомів Ni з'являється заборонена зона  $\varepsilon_2$ . При цьому у кристалі генеруються структурні дефекти акцепторної природи, а в забороненій зоні є<sub>2</sub> виникають акцепторні рівні (зона)  $\varepsilon_A^1$ . Це і є механізм «апріорного

легування» напівпровідника *p*-LuNiSb акцепторними домішками [1].

З іншого боку, одним із способів отримання термоелектричних матеріалів з високими значеннями термоелектричної добротності  $Z \in генерування у$ кристалі структурних дефектів донорної і/абоакцепторної природи, що одночасно приводить до $зміни значень коефіцієнтів термо-ерс <math>\alpha(T,x)$  та теплопровідності  $\kappa(T,x)$ , а також питомої електропровідності  $\sigma(T,x)$  [8].

Саме тому для отримання нового ефективного термоелектричного матеріалу МИ розпочали дослідження напівпровідникового твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, отриманого легуванням сполуки LuNiSb атомами Zr шляхом заміщення у кристалографічній позиції 4*a* атомів Lu. При цьому, у напівпровіднику повинні генеруватися структурні дефекти донорної природи, оскільки Zr ( $4d^25s^2$ ) містить більше dелектронів, ніж атом Lu  $(5d^{1}6s^{2})$ . Вище ми свідомо акцентували увагу на результатах дослідження кристалічної та електронної структур *p*-LuNiSb [6, 7], що знання особливостей тому просторового розташування атомів сполуки LuNiSb дозволить зрозуміти механізм входження у її структуру атомів Zr при отриманні твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb. Представлені нижче перші результати дослідження структурних, кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик напівпровідникового твердого розчину  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0, 10, дозволять як ідентифікувати механізми електропровідності, так і у подальшому уточнити його кристалічну та електронну структури.

### I. Методики дослідження

Сплави твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, x = 0,01 - 0,10, виготовляли сплавленням шихти компонентів, зважених з точністю  $\pm 0,001$  г, в електродуговій печі з вольфрамовим електродом (катод) в атмосфері очищеного аргону під тиском 0,1 кПа на мідному водоохолоджуваному поді (анод). В якості гетеру використовували попередньо сплавлений губчатий титан. З метою досягнення однорідності сплави переплавлялись двічі. Контроль втрат шихти при плавці проводили повторним зважуванням. Термічна обробка сплавів полягала у гомогенізуючому

відпалюванні за температури 1073 К. Відпал зразків проводили на протязі 720 год. у вакуумованих до 1,0 Па ампулах з кварцового скла у муфельних електропечах з регулюванням температури з точністю  $\pm$  10 К. Масиви дифракційних даних отримано на порошковому дифрактометрі DRON-4.0 (Fe*K* $\alpha$ випромінювання), а за допомогою програми Fullprof [9] розраховано структурні характеристики Lu<sub>1-</sub> <sub>x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb. Хімічний та фазовий склади зразків контролювали за допомогою металографічного аналізу (скануючий електронний мікроскоп Tescan Vega 3 LMU).

Дослідження температурних залежностей питомого електроопору  $\rho(T,x)$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$ проводилося у діапазоні температур 80 ÷ 400 К на зразках У вигляді прямокутних паралелепіпедів розміром ~ 1,0×1,0×5 мм<sup>3</sup>. Вимірювання значень електроопору здійснювалося із використанням двоконтактного значень коефіцієнта методу, термо-ерс а потенціометричним методом відносно міді. Для ефектів, зменшення «паразитних» зумовлених впливом термо-ерс у місцях контактів, а також ефектів, зумовлених можливим впливом *p-n* переходу, вимірювання спаду напруги на зразку проводили при різних напрямках електричного струму [10]. Вимірювання значень питомої магнітної сприйнятливості  $\chi(T,x)$  зразків Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb проводили відносним методом Фарадея за температури 293 К з використанням термогравіметричної установки з електронною мікровагою ЭМ-5-ЗМП в магнітних полях до 10 кЕ.

## **II.** Дослідження структурних характеристик Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb

Мікрозондовий аналіз концентрації атомів на поверхні зразків Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, x = 0 - 0.10, встановив їхню відповідність вихідним складам шихти, а рентгенівський фазовий аналіз показав відсутність слідів сторонніх фаз на дифрактограмах зразків, окрім основної фази (рис. 1*a*), яка індексується у структурному типі MgAgAs [2].

Виходячи з того, що атомний радіус Lu  $(r_{Lu} = 0,173 \text{ нм}) \in 6$  більший, ніж Zr  $(r_{Zr} = 0,160 \text{ нм}),$ 



**Рис. 1.** Дифрактограми (а) та зміна значень періоду елементарної комірки a(x) (б) зразків Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb.

логічно було очікувати зменшення значень періоду елементарної комірки  $a(x) Lu_{1-x}Zr_xNiSb$  при заміщенні у позиції 4*a* атомів Lu на атоми Zr. При цьому, як згадувалося вище, у кристалі мають генеруватися структурні дефекти донорної природи, а у забороненій зоні з'являться донорні рівні (зона)  $\varepsilon_D^{-1}$ .

Однак, як видно з рис. 16, на ділянці концентрацій x = 0 - 0,02 значення a(x) Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb стрімко зростають, проходять через максимум і за x > 0,02 так само стрімко спадають. Принагідно зауважимо, що у спорідненому напівпровідниковому твердому розчині Ег<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb ми спостерігали схожу поведінку періоду елементарної комірки a(x): на ділянці x = 0 - 0,02 значення a(x) збільшуються, а за x > 0,05 -зменшується [11].

Немонотонна зміна значень періоду елементарної комірки a(x) Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb (рис. 1 $\delta$ ) та наявність на залежності екстремуму дозволяє припустити, що домішкові атоми Zr, уведені у матрицю пів-Гейслерової фази LuNiSb, можуть одночасно у різних співвідношеннях частково займати як різні кристалографічні позиції, так і генерувати появу вакансій або атомів у тетраедричних пустотах структури, які складають ~ 24 % об'єму елементарної комірки [2].

З огляду на те, що атомний радіус атома Ni  $(r_{Ni} = 0.124 \text{ нм}) \in$  найменшим серед хімічних елементів твердого розчину  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$  ( $r_{Sb} = 0,159$  нм), збільшення значень періоду елементарної комірки a(x)може спричинити часткове зайняття домішковими атомами Zr кристалографічної позиції 4c. Окрім того, ймовірним є повернення Ni у цю позицію, що приведе до ліквідації вакансій. І якщо заміщення у позиції 4*a* атомів Lu на атоми Zr генерує у кристалі структурні дефекти донорної природи, то заміщення атомів Ni  $(3d^84s^2)$  на атоми Zr  $(4d^25s^2)$ супроводжується генеруванням структурних дефектів акцепторної природи, оскільки атом Zr містить менше d-електронів. Одночасно у забороненій зоні Lu<sub>1</sub>. <sub>x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb має з'явитися ще один акцепторний рівень (зона)  $\varepsilon_{A}^{2}$ . У цьому випадку напівпровідник Lu<sub>1</sub>.  $_x$ Zr<sub>x</sub>NiSb, x = 0 - 0.02, буде одночасно містити донори та акцептори, а їхнє співвідношення визначатиме знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  та тип основних носіїв струму.

З іншого боку, якщо пригадати, що наявні у кристалографічній позиції 4с структурні дефекти у вигляді вакансій спричинили появу у забороненій зоні напівпровідника *p*-LuNiSb акцепторних рівнів (зони)  $\varepsilon_{A^{1}}$  [7, 8], то зайняття атомами Ni чи Zr вакансій у позиції 4с також, як і при заміщенні атомів Ni на Zr, приведе до збільшення значень періоду елементарної комірки a(x) Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb. У випадку зайняття атомами Ni чи Zr вакансій у позиції 4c відбувається генеруванням структурних дефектів донорної природи, а в забороненій зоні з'являться два домішкових донорних рівні (зони). Одночасно при цьому зникає структурний дефект акцепторної природи (зникає вакансія) та вілповілний акцепторний рівень (зона)  $\varepsilon_{A}^{1}$ .

Ми свідомі того, що наведені міркування стосовно можливих трансформацій структурних та енергетичних характеристик твердого розчину  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$  лише на основі поведінки періоду елементарної комірки a(x) носять якісний характер. Представлені нижче результати дослідження електрокінетичних, енергетичних та магнітних характеристик зразків  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0,10, будуть у майбутньому слугувати реперними точками, які ми використаємо для моделювання електронної структури твердого розчину, зокрема, трансформації енергетичних зон та рівня Фермі є<sub>F</sub>, а також структурних, моделювання кінетичних та енергетичних характеристик, максимально наближених до реального стану речовини. Однак, це завдання наступної роботи.

## III. Дослідження електрокінетичних, енергетичних та магнітних характеристик Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb

Температурні та концентраційні залежності питомого електроопору  $\rho$  та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha$  зразків Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, x = 0 - 0,10, наведені на рис. 2-4.

Як можемо бачити з рис. 2, для вихідної сполуки *p*-LuNiSb залежність  $\ln(\rho(1/T))$  є характерною для напівпровідників [12] і апроксимується за допомогою відомого співвідношення (1):

$$\rho^{-1}(T) = \rho^{-1} exp\left(\frac{\varepsilon_1^{\rho}}{k_B T}\right) + \rho_3^{-1} exp\left(\frac{\varepsilon_3^{\rho}}{k_B T}\right),\tag{1}$$

де перший високотемпературний доданок описує активацію носіїв струму  $\varepsilon_1^{\rho}$  з рівня Фермі  $\varepsilon_F$  на рівень протікання зон неперервних енергій, а другий, низькотемпературний, – стрибкову провідність по домішкових донорних станах  $\varepsilon_3^{\rho}$  з енергіями, близькими до рівня Фермі  $\varepsilon_F$ . Розрахунки показали, що у дослідженому зразку *p*-LuNiSb рівень Фермі  $\varepsilon_F$  розташовується на відстані  $\varepsilon_1^{\rho} = 10,2$  меВ від стелі валентної зони  $\varepsilon_V$ .



**Рис. 2.** Температурні залежності питомого електроопору  $ln(\rho(1/T))$  (1) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T)$  (2) *p*-LuNiSb.

У свою чергу, температурні залежності коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(1/T)$  *p*-LuNiSb (рис. 2) описуються відомим виразом (2) [13]:

$$\alpha = \frac{k_B}{e} \Big( \frac{\varepsilon_i^{\alpha}}{k_B T} - \gamma + 1 \Big), \tag{2}$$

де  $\gamma$  – параметр, що залежить від природи механізму розсіювання. З високо- та низькотемпературних активаційних ділянок залежності  $\alpha(1/T)$  обчислено відповідно значення енергій активації  $\varepsilon_1^{\alpha} = 35,3$  меВ та  $\varepsilon_3^{\alpha} = 1,9$  меВ які, як показано в [1], пропорційні амплітуді великомасштабної флуктуації зон неперервних енергій та дрібномасштабної флуктуації сильнолегованого та сильнокомпенсованого напівпровідника (СЛСКН) [12].

Наявність високотемпературної активаційної ділянки на температурній залежності питомого опору  $\ln(\rho(1/T))$  *p*-LuNiSb вказує на розташування рівня Фермі  $\varepsilon_F$  у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  напівпровідника, а додатні значення коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  за цих температур уточнюють його положення – поблизу валентної зони  $\varepsilon_V$ . Отже, дірки є основними носіями електричного струму. Отримані значення енергій активації  $\varepsilon_1^{\rho}$  та  $\varepsilon_1^{\alpha}$  для *p*-LuNiSb узгоджуються з результатами попередніх досліджень [1].

У даному контексті цікавим є питання стосовно «частки» атомів Ni, які відсутні у кристалографічній позиції 4c, що породжує вакансії у цій позиції та акцепторні рівні (зону)  $\varepsilon_A^1$  у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  напівпровідника *p*-LuNiSb [6, 7]. Оскільки при синтезі зразків LuNiSb шихта готувалася відповідно до еквіатомного складу сполуки, а мікрозондовий аналіз концентрації атомів на поверхні зразків встановив їхню відповідність вихідним складам шихти, то куди поділися ~ 6 % атомів Ni?

Можемо припустити, що значна їх частина зайняла тетраедричні пустоти структури, які складають ~ 24 % об'єму елементарної комірки [2], генеруючи при цьому структурні дефекти донорної природи. І саме співвідношення концентрації іонізованих акцепторів, породжених вакансіями у позиції 4*c*, та донорів (атоми Ni у тетраедричних пустотах) визначає положення рівня Фермі  $\varepsilon_F$  у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  напівпровідника *p*-LuNiSb. Адже відсутність компенсуючих донорів у *p*-LuNiSb за гігантської концентрації акцепторів (~ 6%) привела би до занурення рівня Фермі  $\varepsilon_F$  глибоко у валентну зону  $\varepsilon_V$  та повної металізації електропровідності. Однак згідно експериментальних даних, рівень Фермі у *p*-LuNiSb лежить у забороненій зоні  $\varepsilon_g$  біля стелі валентної зони  $\varepsilon_V$ , що може спричинити лише наявність у кристалі компенсуючих структурних дефектів донорної природи, якими, як ми вважаємо, є атоми Ni у тетраедричних пустотах.

Легування *p*-LuNiSb найменшою в експерименті концентрацією домішкових атомів Zr (x = 0.01) радикально змінює як характер поведінки температурних залежностей питомого електроопору  $\rho$ та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha$ , так і тип основних носіїв електричного струму (рис. 3). Металічний (не активаційний) характер поведінки температурних залежностей питомого електроопору  $\rho(T.x)$ Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb (рис. 3a) однозначно вказує, що рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  покинув заборонену зону  $\varepsilon_{\rm g}$  і знаходиться у зоні неперервних енергій. Те, що такою зоною є зона провідності напівпровідника є можна стверджувати на основі від'ємних значень коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  (рис. 3б) за всіх концентрацій та температур. Зрозуміло, що збільшення значень  $\rho(T,x)$  Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb з ростом температури обумовлене наявними у напівпровіднику механізмами розсіювання носіїв струму.

Отриманий результат, особливо повна металізація електропровідності Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb вже за найменшої концентрації домішки, був абсолютно неочікуванним. За нашими оцінками, якби у кристалографічній позиції 4*а* відбувалося заміщення атомів Lu на атоми Zr і в напівпровіднику генерувалися б донори, то за концентрації  $x \approx 0.02$  рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  знаходився біля середини забороненої зони є<sub>g</sub>, а на температурних залежностях питомого електроопору присутніми були високотемпературні активаційні ділянки, засвідчуючи активацію носіїв струму з рівня Фермі є<sub>F</sub> у зони неперервних енергій. Так, за *x* < 0.02 знак коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  був би додатним, бо рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$ був ближче до стелі валентної зони і дірки є основними носіями струму, а за x > 0,02 - від'ємним. І лише за концентрацій x > 0.04 рівень Фермі  $\varepsilon_{\rm F}$  мав перетнути дно зони провідності  $\varepsilon_{\rm C}$ , що привело би до зникнення активаційних ділянок на температурних залежностях питомого електроопору  $\ln(\rho(1/T))$  Lu<sub>1</sub>-



**Puc. 3.** Температурні залежності питомого електроопору  $\rho(T,x)$  (**a**) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(T,x)$  (**б**) Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb: 1 - x = 0,01; 2 - x = 0,02; 3 - x = 0,05; 4 - x = 0,07; 5 - x = 0,1.

"Zr"NiSb та металізації провідності.

Як наслідок, неочікуваним також виявився характер зміни значень питомого опору  $\rho(x,T)$  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$  за всіх температур (рис. 4*a*). Якщо у напівпровіднику одночасно присутні два типи носіїв електричного струму, то максимум на залежності  $\rho(x,T)$  свідчить, що концентрації наявних іонізованих акцепторів та донорів урівноважені. У випадку Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb такий максимум ми очікували за концентрації  $x \approx 0,02$ . Наявний на рис. 4*а* максимум  $\rho(x,T)$  Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за  $x \approx 0,01$  нічого спільного з викладеною думкою не має. Адже за x = 0 маємо напівпровідник діркового типу провідності, коли рівень Фермі є<sub>F</sub> лежить на відстані 10,2 меВ від краю валентної зони  $\varepsilon_V$ , а вже за концентрації x = 0.01 він розташований глибоко у зоні провідності єс і електрони є основними носіями струму. Це саме стосується і характеру зміни значень коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb, зокрема, наявного мінімуму за  $x \approx 0.01$  (рис. 4б). Коректно вести мову лише про зменшення значень  $\rho(x,T)$  та ріст значень Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb на ділянці  $\alpha(x,T)$ концентрацій  $0,01 \le x \le 0,10$  за всіх температур (рис. 4), що вказує на збільшення концентрації електронів та густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_{\rm F})$ . Це зрозуміло, адже атоми Zr, заміщаючи Lu, генерують структурні дефекти донорної природи, які постачають у напівпровідник

#### електрони.

Надзвичайно цікавими та інформативними виявилися результати обчислення З низькотемпературних активаційних ділянок залежностей  $\alpha(1/T)$  Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb енергій активації  $\varepsilon_{1}^{\alpha}(x)$  (рис. 5*a*), значення яких пропорційні амплітуді великомасштабної флуктуації зон неперервних енергій СЛСКН, викликаних флуктуаційним характером розташування у просторі кристалу заряджених центрів, зокрема, іонізованих акцепторів та донорів [12].

Чим вищою e ступінь компенсації напівпровідника (співвідношення іонізованих акцепторів та донорів), тим більшим є спотворення зон неперервних енергій та значення амплітуди модуляції зон неперервних енергій. Одразу зазначимо, що коректним є аналіз поведінки енергії активації  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)$  Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb лише на ділянці концентрацій  $0,01 \le x \le 0,10,$ коли провідність напівпровідника визначає один тип основних носіїв. Адже за x = 0 маємо напівпровідник діркового типу провідності, а за  $x \le 0,01-$  електронного.

З рис. 5*a* слідує, що за концентрацій  $0,01 \le x \le 0,10$ значення енергії активації  $\mathcal{E}_1^{\alpha}(x)$ Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb стрімко спадають, засвідчуючи стрімке переважання концентрації одного типу носіїв електричного струму над іншим. Оскільки основними



Рис. 4. Зміна значень питомого електроопору  $\rho(x, T)$  (a) та коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x, T)$  (б) Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за різних температур: 1 – T = 380 K; 2 – T = 250 K; 3 – T = 160 K; 4 – T = 80 K.



**Рис. 5.** Зміна значень енергії активації  $\varepsilon_1^{\alpha}(x)(\mathbf{a})$  і магнітної сприйнятливості  $\chi(x)(\mathbf{6})$  Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb при T = 293 K.

носіями струму Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за  $0,01 \le x$  є електрони і їхня концентрація є набагато більшою, ніж дірок, то з ростом концентрації домішки співвідношення концентрації донорів до дірок збільшується (ступінь компенсації зменшується).

У класичному випадку легування, наприклад, напівпровідника *p*-типу провідності донорною домішкою приводить спочатку до захоплення вільних електронів акцепторами (іонізація акцепторів) до концентрацій, коли число акцепторів відповідає числу іонізованих донорів. За більших концентрацій, коли всі акцептори іонізовані, поставлені донорами електрони стають колективізованими (вільними) та беруть участь в електропровідності. Тобто, спочатку електрони захоплюються наявними в напівпровіднику акцепторами [10].

Логічним виглядає запитання стосовно причини такої некласичної поведінки кінетичних характеристик Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb. Тобто, які структурні зміни у Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb могли спричинити такий суттєвий вплив на електронну систему напівпровідника, що відображено у наведених вище його електрокінетичних характеристиках?

Згадаємо, що у структурі p-LuNiSb одночасно присутні ~6% вакансій у позиції 4c атомів Ni, що генерує структурні дефекти акцепторної природи, а у *ε*<sub>g</sub> з'являється забороненій зоні відповідний акцепторний рівень (зона)  $\varepsilon_{A}^{1}$ . Окрім того, структурні дослідження Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb показали, що збільшення значень періоду елементарної комірки a(x) на ділянці концентрацій x = 0 - 0.02 (рис. 16) спричинене саме зайняттям домішковими атомами Zr наявних у структурі вакансій та поверненням у позицію 4с атомів Ni. При цьому відбувається генерування структурних дефектів донорної природи, а в забороненій зоні з'являться донорні рівні (зони). Одночасно у позиції 4с зникає структурний дефект акцепторної природи (зникає вакансія) та відповідний акцепторний рівень (зона)  $\varepsilon_{A}^{1}$ .

Отже, одночасне зникнення акцепторів (не компенсація електронами, а саме зникнення) та включення таких механізмів генерування донорів:

– зайняття атомами Zr кристалографічної позиції 4c (вакансій);

– повернення атомів Ni у позицію 4*c*.

– заміщення атомами Zr атомів Lu у кристалографічній позиції 4*a*;

– зайняття атомами Zr тетраедричних пустот структури

є причиною появи у напівпровіднику Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb гігантської концентрації донорів, які спричинили розташування рівня Фермі  $\varepsilon_F$  у зоні провідності  $\varepsilon_C$ , збільшення густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_F)$  та металізацію електропровідності.

Експериментальні дослідження магнітної

сприйнятливості  $\chi(x)$  показали, що зразки як сполуки LuNiSb, так і твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за всіх концентрацій є парамагнетиками Паулі (рис. 5*b*). У цьому випадку зрозумілою є подібність поведінки залежностей питомого опору  $\rho(x,T)$  (рис. 4*a*), коефіцієнта термо-ерс  $\alpha(x,T)$  (рис. 4*б*) та магнітної сприйнятливості  $\chi(x)$  (рис. 5*b*), пов'язані зі зміною густини станів на рівні Фермі  $g(\varepsilon_F)$ .

Отже, дослідження напівпровідникового твердого розчину  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$ , отриманого легуванням сполуки LuNiSb атомами Zr шляхом заміщення у кристалографічній позиції 4*а* атомів Lu показало складний характер входження атомів домішки у матрицю сполуки, коли одночасно відбуваються зміни у кількох кристалографічних позиціях та у міжвузлях кристалу. Однак дане питання вимагає додаткових досліджень, зокрема структурних та моделювання електронної структури напівпровідникового твердого розчину Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb за різних умов входження у структуру домішкових атомів Zr, а наведені експериментальні результати будуть слугувати при розрахунках реперними точками, що буде завданням наступної роботи.

## Висновки

Отже, на основі результатів дослідження структурних, кінетичних, енергетичних та магнітних характеристик зразків твердого розчину  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$ , x = 0 - 0, 10,встановлено, що для забезпечення структури стійкості та принципу електронейтральності у напівпровіднику одночасно генеруються як структурні дефекти акцепторної природи, так і донорної (ефективний заряд яких є протилежним), концентрація яких росте при збільшенні вмісту атомів Zr. Досліджений твердий  $Lu_{1-x}Zr_xNiSb$ перспективним розчин € термоелектричним матеріалом.

#### Подяка

Робота виконана у рамках гранту МОН України № 0121U109766.

*Ромака В.* – професор, д.т.н.; *Стадник Ю.* – к.х.н., пров.н.сп. кафедри неорганічної хімії; *Ромака Д. – к.*х.н. пров.н.сп. кафедри неорганічної

*Ромака Л.* – к.х.н., пров.н.сп. кафедри неорганічної хімії;

*Горинь А.* – к.х.н., ст.н.сп. кафедри неорганічної хімії; *Пашкевич В.* – к.т.н., доцент;

*Ничипорук Г.* – к.х.н., ст.н.сп. кафедри неорганічної хімії;

*Гаранюк П.* – к.т.н., доцент.

- [1] V.A. Romaka, Yu.V. Stadnyk, V.Ya. Krayovskyy, L.P. Romaka, O.P. Guk, V.V. Romaka, M.M. Mykyychuk, A.M. Horyn, The latest heat-sensitive materials and temperature transducers (Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, 2020); ISBN 978-966-941-478-6 [in Ukrainian].
- [2] V.V. Romaka, L.P. Romaka, V.Ya. Krayovskyy, Yu.V. Stadnyk, Stannides of rare earths and transition metals (Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, 2015); ISBN 978-617-607-816-6 [in Ukrainian].

- [3] I. Karla, J. Pierre, R.V. Skolozdra, J. Alloys Compd. 265, 42 (1998); <u>https://doi.org/10.1016/S0925-8388(97)00419-2</u>).
- [4] R.V. Skolozdra, A. Guzik, A.M. Goryn, J. Pierre, Acta Phys. Polonica A 92, 343 (1997); <u>https://doi.org/10.12693/APhysPolA.92.343</u>.
- [5] T. Harmening, H. Eckert, R. Pöttgen, Solid State Sci. 11(4), 900 (2009); <u>https://doi.org/10.1016/j.solidstatesciences.2008.12.007.</u>
- [6] V.V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, P. Rogl, Yu. Stadnyk, N. Melnychenko, M. Orlovskyy, V. Krayovskyy, J. Solid State Chem. 239, 145 (2016); <u>https://doi.org/10.1016/j.jssc.2016.04.029</u>).
- [7] V.V. Romaka, L. Romaka, A. Horyn, Yu. Stadnyk, J. Alloys Compd. 855, 157334 (2021); https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2020.157334.
- [8] L.I. Anatychuk, Thermoelements and thermoelectric devices (Naukova dumka, Kyiv 1979) [in Russian].
- [9] T. Roisnel, J. Rodriguez-Carvajal, Mater. Sci. Forum, Proc. EPDIC7, 378-381, 118 (2001); https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.378-381.118.
- [10] V.P. Babak, V.V. Shchepetov, J. Friction and Wear. 39, 38 (2018); https://link.springer.com/article/10.3103/S1068366618010038.
- [11] Yu. Stadnyk, L. Romaka, V.A. Romaka, A. Horyn, V. Krayovskii, P. Klyzub, M. Rokomanyuk, XXII Intern. Sem. Phys. Chem. Solids, June 17-19 (Lviv, Ukraine, 2020). P. 35.
- [12] B.I. Shklovskii and A.L. Efros, Electronic Properties of Doped Semiconductors (Springer, NY, 1984).
- [13] N.F. Mott and E.A. Davis, Electron Processes In Non-crystalline Materials (Clarendon Press, Oxford, 1979).

## V.A. Romaka<sup>1</sup>, Yu. Stadnyk<sup>2</sup>, L. Romaka<sup>2</sup>, A. Horyn<sup>2</sup>, V. Pashkevich<sup>1</sup>, H. Nychyporuk<sup>2</sup>, P. Garanyuk<sup>1</sup>

## Investigation of Thermoelectric Material Based on Lu<sub>1-x</sub>Zr<sub>x</sub>NiSb Solid Solution. I. Experimental Results

<sup>1</sup>Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine, <u>volodymyr.romaka@gmail.com</u>; <sup>2</sup>Ivan Franko L'viv National University, L'viv, Ukraine, <u>lyubov.romaka@gmail.com</u>

The effect of doping of half-Heusler phase *p*-LuNiSb (MgAgAs structure type) by Zr atoms on the structural, kinetic, energetic and magnetic characteristics of the semiconductor solid solution  $Lu_{1-x}Zr_x$ NiSb was studied in the ranges: T = 80 - 400 K, x = 0 - 0.10. From experimental studies it has been established that doping of *p*-LuNiSb compound with Zr atoms simultaneously generates both structural defects of acceptor and donor nature, the concentration of which increases with increasing content of Zr atoms. It was shown that the investigated semiconductor solid solution  $Lu_{1-x}Zr_x$ NiSb is a promising thermoelectric material.

Keywords: semiconductor, electrical conductivity, thermopower coefficient, Fermi level.